

集光型 CVD 炉チーム

<氏名> 池田 伸一

<役職> チームリーダー

<所属> 産業技術総合研究所

<開発内容>

集光型 CVD 炉チームは、ランプを加熱源とした CVD 装置を開発します。原料ガスの供給、除害機構の小型化を進め、ミニマル CVD 装置として完成させます。電力と原料ガスの使用量を極限まで少なくした CVD プロセス技術を開発します。光反射材料と反射鏡形状の最適化によって、加熱効率改善を図ります。

*CVD(chemical vapor deposition)：化学気相成膜

<自己紹介>

大学院では物理学を専攻、修士過程終了後に電機メーカーでマグネトロンプラズマ装置開発に従事、博士課程では金属酸化物磁性体の単結晶成長とその磁性を研究した。

電子技術総合研究所（現産総研）入所以降、無機材料の物質開発と集光加熱技術の応用を進めてきた。

現在は、ナノエレクトロニクス研究部門ミニマルシステムグループ、及び、MINIMAL(技術研究組合)の一員としてミニマルファブ構築を目指している。

詳細は、以下の HP を参照して下さい。

<http://staff.aist.go.jp/ikedashin/profile.html>

